7C-2 耐振動型フィードバック位相シフト半導体レーザ干渉計

高橋 勉\* 鈴木 孝昌\*\* 佐々木 修己\*\* \*新潟大学大学院自然科学研究科 \*\*新潟大学工学部

1. はじめに

干渉計測における位相シフト法はノイズ成分に強いため、最もよく使用される解析法の1つである P。

またフィードバック(FB)制御を行うことで、外 乱に強い半導体レーザ(LD)干渉計を構成すること ができる。。しかしFB制御した状態で注入電流に よる位相シフト法を行う場合、正帰還での動作が不 安定になるため画像取得が難しい。

そこで本研究では干渉縞輝度に着目し、縞の明暗 がπ/2ずつ変化する4枚の画像が取得できるよう に信号処理を行う。

加えて位相シフト法はデータ処理に手間がかかる ため、信号処理回路と計算機処理の同期をとること でシステムの効率化を図った。

## 2. 原理

図1は干渉縞のある1点での輝度変化を示したも のである。

位相シフト法は位相が $\pi/2$ ずつ変化した4枚の 干渉縞画像を用いて位相分布を計算する方法である。

F B 制御を行わない場合、S<sub>1</sub>,S<sub>2</sub>,S<sub>3</sub>,S<sub>4</sub> での画像を 用いて計算を行う。

FB制御を行う場合、S1,S2では負帰還となり安定 であるが、S3,S4では傾きが逆転し正帰還となるため 不安定である。そこで S3では S1と同レベルの注入 電流を加えた後に極性を反転することで S3'を得る。 同様に S4では S2から S4を得る。S3',S4'は S1,S2と同 じ傾きであり、安定にFB制御を行うことが可能で ある。S3',S4'の時にCC1)カメラへ取り込まれる干 渉縞画像は S3,S4と同じである。

F B 制御を行う場合、S1,S2,S3',S4'での画像を用い て計算を行う。

$$S_1 = B\cos(\phi) \qquad \cdots (1)$$

$$S_2 = B\cos(\phi + \frac{\pi}{2}) \qquad \cdots (2)$$

$$S_3 = B\cos(\phi + \pi) \qquad \cdots (3)$$

$$S_4 = B\cos(\phi + \frac{3\pi}{2}) \qquad \cdots (4)$$

となる。位相分布øは

$$\phi = \tan^{-1}(\frac{S_4 - S_2}{S_1 - S_3}) \qquad \dots (5)$$

で求めることができる。



図1 位相シフト法におけるFB制御

3.実験装置の構成

図2に実験装置の構成を示す。

最大出力50mW、発振波長685nmのLDを用い、 トワイマン・グリーン型干渉計を構成した。



図2 実験装置の構成

図3に信号処理部の構成を示す。

干渉信号をPDとCCDカメラで受光する。CC Dの映像信号から分離した同期信号より位相シフト 電圧の出力タイミング信号を生成する。このタイミ ング信号に同期して画像取得と位相シフトを行う。 位相シフトは位相シフト電圧とPDの出力とを比較 し、FB制御をかけながら行った。



図3 信号処理部の構成

## 4. 実験結果

図4に位相シフト電圧 Vm とフィールド信号を示 す。Vmが1~IVのときに画像取得を行う。



図4 位相シフト電圧

図5に1~IVでの画像を示す。FB制御した状態 で位相シフトが正しく行われていることが確認でき る。



## 図5 干渉縞の変化

次に構成した干渉計を用いて、磁気ディスク用ア ルミニウム円板の表面形状を測定した。結果を図6 に示す。表面の凹凸の周期は約40μm、高さは約 35nmであり、これは接触型の粗さ計で測定した 値とほぼ一致した。



図6 アルミニウム円板の表面形状

<u>5. まとめ</u>

位相シフト法を用いた画像データ処理システムを 構成した。次にFB制御を行い、外乱の影響を低減 できることが確認できた。そして磁気ディスク用ア ルミニウム円盤の表面形状を測定した。

## 【参考文献】

- 1) D. Malacara, "Optical shop testing,"
  - (Wiley, 1992), p.p. 501-513.
- 2) O.Sasaki, et. al., Opt. Eng., Vol. 29, 1511, (1990).